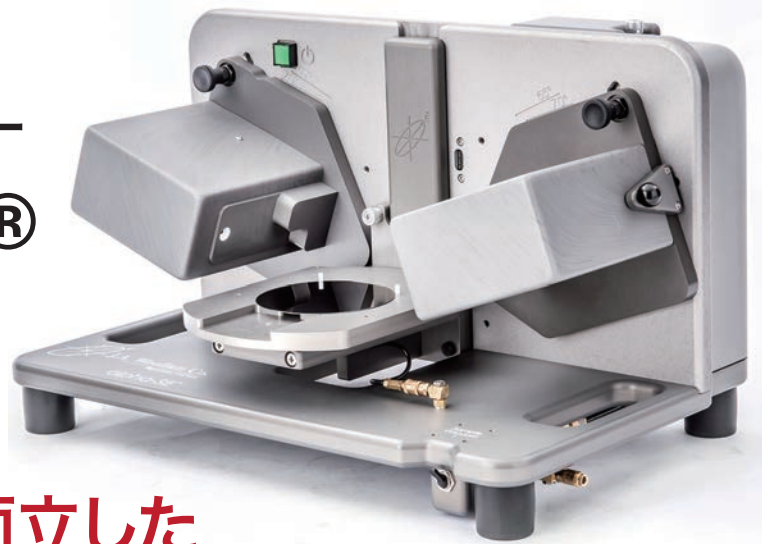


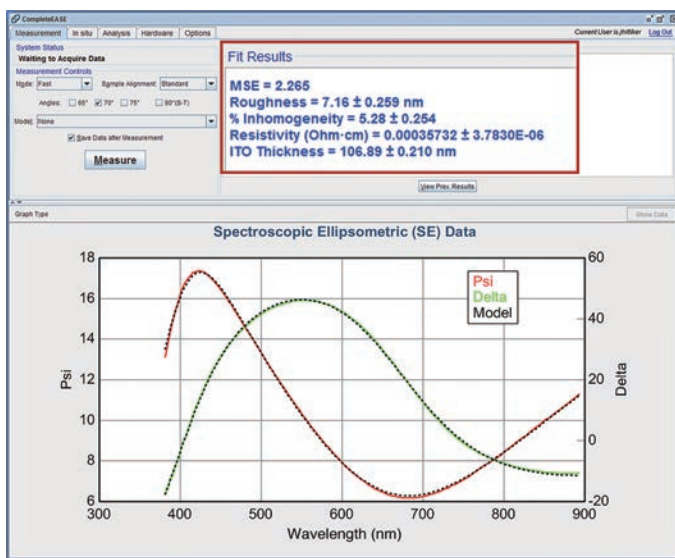
J. A. Woollam Co., Inc. 社製  
簡易高速分光エリプソメーター

# alpha-SE<sup>®</sup>



## 使いやすさと高性能を両立した 簡易型分光エリプソメーター登場！

薄膜の膜厚と屈折率のルーチン測定には、「使いやすさ」と「高性能」を両立した alpha-SE<sup>®</sup> が最適です。サンプル膜に合った光学モデルを選び、サンプルを置いて測定ボタンを押すだけで、数秒のうちに結果が得られます。



測定・解析画面例

### 特長

#### ★ 使いやすさ

簡単なボタン操作で、高性能なソフトウェアがあなたの測定解析を完全サポート

#### ★ 高性能

実績のある分光エリプソメトリー技術が、他の測定法に比べ遙かに高い精度の膜厚・光学定数を提供

#### ★ 柔軟性

誘電体・半導体・有機物など様々な物質の測定解析に対応

#### ★ コストパフォーマンス

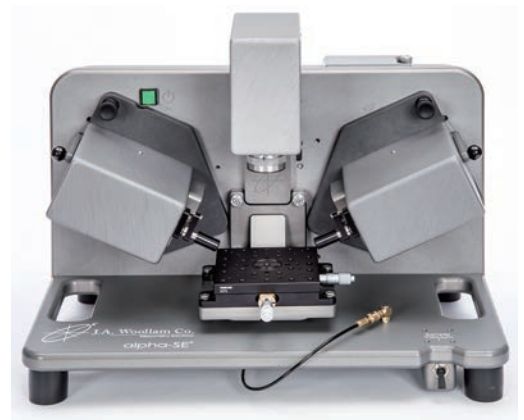
高度な分光エリプソメトリー技術をリーズナブルな価格で提供

#### ★ 高速測定

わずか数秒で全波長データの同時サンプリング

### 主な仕様

- ・波長範囲：380nm～900nm (180波長)
- ・入射角：65°、70°、75°、90° (透過配置)
- ・システム概要：回転補償子方式 (特許取得済み)、CCD分光検出器搭載
- ・コンピュータ接続：USBポート
- ・サンプル高さ：自動調整
- ・データ取得時間：3秒 (高速モード)、10秒 (標準モード)、30秒 (高精度モード)

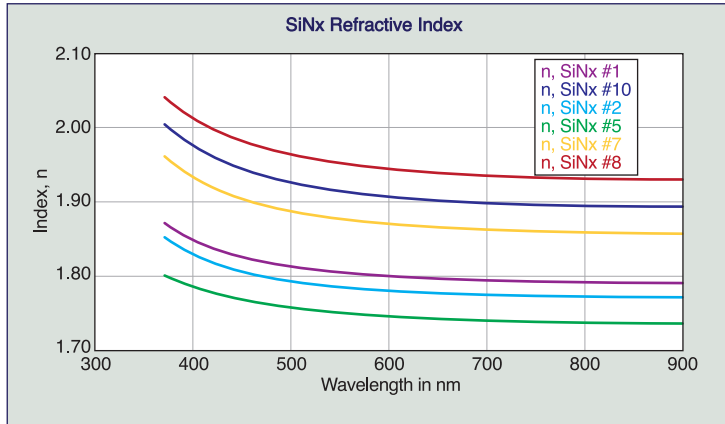


alpha-SE：オプション装着例

## 応 用

### 誘電体膜の評価

**alpha-SE<sup>®</sup>**は測定スピードが速く、操作は測定ボタンを押すだけなので、迅速な薄膜の評価に最適です。シリコン基板またはガラス基板上の単層誘電体膜もほんの数秒で測定することができ、得られた結果は、下図のように、重ね書きグラフおよび数値リストで表示されるため、サンプル間の比較解析も容易です。



Comparison				
Entry Comparison Table				
	MSE	Roughness (nm)	Thickness # 1 (nm)	Index @ 632.8 nm
SiNx #1				
SiNx #10	4.432	1.59	93.02	1.905
SiNx #2	4.356	2.05	96.33	1.779
SiNx #3	6.244	1.47	91.84	1.799
SiNx #4	5.872	1.02	94.20	1.775
SiNx #5	3.122	3.29	101.37	1.745
SiNx #6	5.845	1.29	92.71	1.802
SiNx #7	4.975	2.16	96.72	1.867
SiNx #8	3.581	2.90	87.54	1.942
SiNx #9	3.804	2.34	88.37	1.941
Average	4.65733	2.077	93.529	1.83540
Std. Dev.	1.05345	0.737	4.033	0.07233

Reverse Columns/Rows  Add Statistics

### シリコン窒化膜の屈折率がプロセス条件によって変化するようす

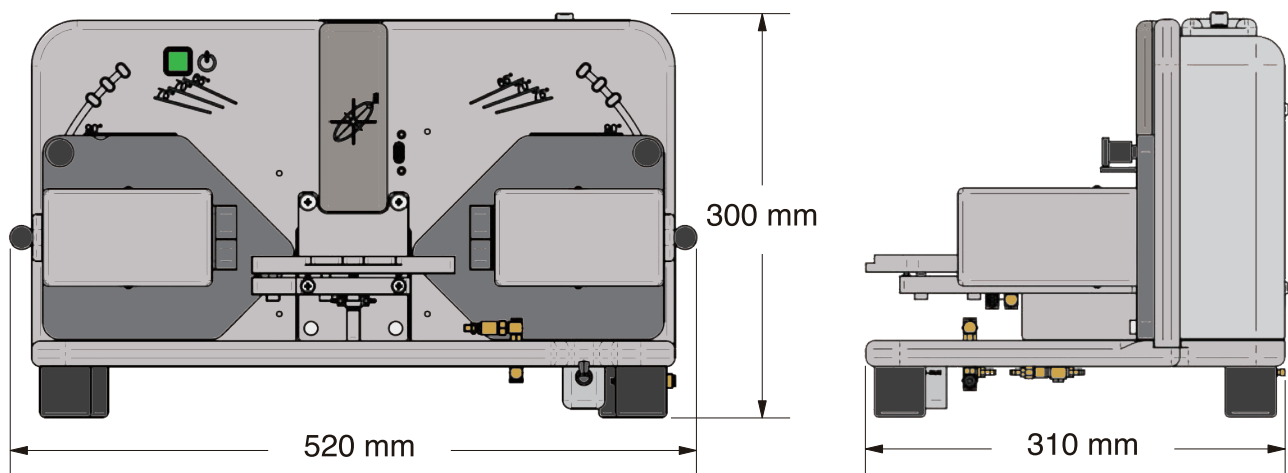
シリコン窒化膜(SiNx)の屈折率および膜厚が、各プロセス条件によって変化するようすを、重ね書きグラフおよびリスト表示によって、素早く比較することができます。

## ユーティリティー

電源 100-240VA, 1A, 47-63Hz

重量 18 kg

コンピューター Windows7またはそれ以上, USBポートver. 1.1またはそれ以上



※本仕様書に記載されている各仕様は、改善のため予告なく変更される場合があります。

### ●お問い合わせは ...

有限会社 テクノ・シナジー  
 〒193-0832 東京都八王子市散田町 2-46-16  
 TEL & FAX: 042-667-1992  
 E-mail: get\_info@techno-synergy.co.jp  
 http://www.techno-synergy.co.jp/

### ●輸入元



ジェー・イー・ウーラム・ジャパン株式会社  
 167-0051 東京都杉並区荻窪5-22-9 藤ビル 2F  
 Phone 03-3220-5871 Fax 03-3220-5876